

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-243420

(P2002-243420A)

(43) 公開日 平成14年8月28日 (2002.8.28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	サーチコード* (参考)
G 0 1 B 11/24		G 0 1 B 9/02	2 F 0 6 4
9/02		11/24	D 2 F 0 6 5
			A

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全9頁)

(21) 出願番号 特願2001-42062(P2001-42062)

(22) 出願日 平成13年2月19日 (2001.2.19)

(71) 出願人 899000046

関西ティール・エル・オー株式会社

京都府京都市下京区中堂寺粟田町1番地

(72) 発明者 石丸 伊知郎

香川県高松市林町2217-20 香川大学工学

部内

(74) 代理人 100095670

弁理士 小林 良平 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 立体形状測定装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 被測定物の比較的広い範囲の立体形状を、短時間で、非接触に測定する。

【解決手段】 被測定物に光を照射した時の反射光のうち直接反射光(0次光)を分別光学系により位相可変フィルタの可動反射部に、高次回折光を固定反射部に導き、それぞれ反射した後、干渉光学系により略1点に収束させて両者を干渉させる。このような状態で、位相可変フィルタの可動反射部を、使用する光の波長の範囲内で移動させると、そこで反射される0次光の位相が固定反射部で反射される高次回折光の位相から徐々にずれ、干渉光学系の結像点における両光の干渉光の強度が徐々に変化する。干渉光の最大強度点での位相可変フィルタの可動反射部の位置は、被測定物における出発点(反射点)と可動反射部との距離に依存するため、その位置より、出発点の位置を算出できる。

